PICTURE DISPLAY DEVICE AND ITS PRODUCTION

Publication number: JP7140903 Publication date: 1995-06-02

Inventor: SAKANO YOSHIKAZU: KA

SAKANO YOSHIKAZU; KAWATE SHINICHI; KANEKO KUMIKO

Applicant: CANON KK

Classification:

- international: G09F9/00; H01J5/02; H01J9/26; H01J29/86; H01J31/12; G09F9/00; H01J5/02; H01J9/26;

H01J29/86; H01J31/12; (IPC1-7): G09F9/00

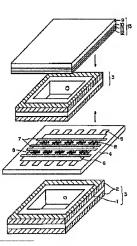
- European:

Application number: JP19930292228 19931122 Priority number(s): JP19930292228 19931122

Report a data error here

Abstract of JP7140903

PURPOSE: To keep a space between a face plate and a rear plate constant and to reduce fine cracks and sealing failures at sealing parts by joining respective vessel members under the condition substantially without intervening sealing agents. CONSTITUTION:An outer frame member 1, a face plate 13 and a rear plate 4 are formed of glass base body of blue plate, quartz, etc., or ceramic base body of Al2O3, etc. Respective members 1, 13 and 4 have parts at which these members are in contact with each other. A sealing agent housing part in which sealing agents 2 are stored in the outer frame member 1 is machined by methods such as chemical etching and mechanical grinding to form a desired shape. The frame member 3 formed of the outer frame member 1 and the sealing agent 2 is arranged on the rear plate 4 on which an electron beam generating device is formed, further the face plate 13 is arranged thereon and then heating at the temp. at which low melting point frit glass used for the sealing agent 2 melts is applied thereto to weld the frame and face plate. Pressing from the face plate 13 side or from the rear plate 4 side is applied if necessary.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Family list

1 family member for: JP7140903

Derived from 1 application

Back to JP714090

PICTURE DISPLAY DEVICE AND ITS PRODUCTION

Inventor: SAKANO YOSHIKAZU; KAWATE

SHINICHI: (+1)

IPC: G09F9/00: H01J5/02; H01J9/26 (+8) EC:

Publication info: JP7140903 A - 1995-06-02

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Applicant: CANON KK

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-140903

(43)公開日 平成7年(1995)6月2日

(51) Int.Cl.6		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
G 0 9 F	9/00	301	7610-5G		

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 8 頁)

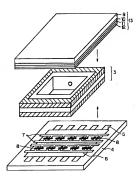
(21)出顯番号	特順平5-292228	(71)出順人	000001007 キヤノン株式会社
(22)出顧日	平成5年(1993)11月22日		東京都大田区下丸子3丁目30番2号
(62) (118 H C)	+100 +(1000)11/12011	(72)発明者	坂野 嘉和
			東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内
		(72)発明者	河手 信一
			東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内
		(72)発明者	金子 久美子
			東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内
		(74)代理人	弁理士 若林 忠

(54) 【発明の名称】 画像表示装置およびその製造方法

(57) 【要約】

【構成】 (1) リアプレートと外枠解析および/また はフェースプレートと外枠解析と変換機関してから、 その機関部周囲を封着すで感形に対常するか、あるいは (2) 外枠部材の接合面の一部に溝を設けて対常材収納 都を形成し、の政熱部に対策を入れ、リアプト および/またはフェースプレートを機器 加圧し、封着 材を加熱体成して封着し、内部の空間を真空排気して面 像表示機度を製造する。

【効果】 (1) フェースプレートとリアプレートとの 間隔を一定にでき、(2) 資券部分での数かクラック、 封着不良が低減し、歩留りが向上し、(3) 封着材の独 布厚を削割する必要がないため、製造方法を簡易とする ことができる。



[特許請求の顧開]

【請求項1】 画像表示面を有する容器部材を含む2以 上の容器部材が接合されてなる外囲器を具備した画像表 示装置において、各容器部材が、直接接触し、かつ該接 触部分の周囲が封着材で気密に封着され接合されている ことを特徴とする画像表示装置。

1

【請求項2】 阿像表示面を有する容器部材を含む2以 上の容器部材が接合されてなる外囲器を具備した画像表 示装置において、各容器部材は、その接合面の一部に封 着材が収納された溝を有し、該封着材を介して相互に接 10 触し封着され接合されていることを特徴とする画像表示 装置。

【請求項3】 画像表示面を有する容器部材を含む2以 上の容器部材が接合されてなる外囲器を具備した画像表 示装置において、少なくとも1以上の容器部材は、その 接合面の外周に枠を有し、該枠の内側でかつ該枠には接 しないように他の容器部材と接触し、該接触部と該枠の 間隙に封着材が収納された状態で封着され接合されてい ることを特徴とする関像表示装置。

「請求項4】 外開器を構成する容器部材は、(a) 両 20 像表示面を有するフェースプレート、(b) 該フェース プレートに対向して配置されたリアプレート、ならびに (c) フェースプレートおよびリアプレート間の周縁部 に介在する外枠部材の3種である請求項1ないし3のい ずれか1項に記載の画像表示装置。

【請求項5】 フェースプレートの画像表示面には電子 線の励起により発光する蛍光部材および電圧印加手段が 形成されており、リアプレートに少なくとも1以上の電 子線発生版が形成されている請求項4記載の画像形成装

「鯖求項6】 画像表示面を有する容器部材を含む2以 上の容器部材を接合して外囲器形成する工程と、該工程 後に該外囲器内部の空間を真空排気する工程とを有して たる画像表示装置の製造方法において、外囲界形成を、 各容器部材を直接接触させ、次に該接触部分の周囲を封 着材で気密に封着し接合して行なうことを特徴とする画 像表示装置の製造方法。

【請求項7】 画像表示面を有する容器部材を含む2以 上の容器部材を接合して外囲器形成する工程と、該外囲 器内部の空間を真空排気する工程とを有してなる画像表 40 し、その後内部を真空排気する。 示装置の製造方法において、外囲器形成を、各容器部材 の接合面の1部に溝を設け、該溝内部に封着材を入れ、 各容器部材をその接合面で相互に接触させて封着し接合 して行なうことを特徴とする画像表示装置の製造方法。

【請求項8】 画像表示面を有する容器部材を含む2以 上の容器部材を接合して外囲器形成する工程と、該外囲 器内部の空間を真空排気する工程とを有してなる画像表 示装置の製造方法において、外囲器の形成を、少なくと も1以上の容器部材の接合面の外間に枠を設け、該容器 部材を枠の内側でかつ該枠には接しないように他の容器 50 じることから、フェースプレートの発光部の形状にバラ

2 部材と接触させ、該接触部と該枠の間隙に封着材を入 れ、次に封着し接合することによって行なうことを特徴 とする画像表示装置の製造方法。

【請求項9】 外囲器を構成する容器部材を、(a) 画 像表示面を有するフェースプレート、(b) 該フェース プレートに対向して配置されたリアプレート、ならびに (c) フェースプレートおよびリアプレート間の周縁部 に介在する外枠部材の3種とする請求項6ない1.8のい ずれか1項に記載の画像表示装置の製造方法。

【請求項10】 フェースプレートの画像表示面には電 子線の励起により発光する蛍光部材および電圧印加手段 が形成されており、リアプレートに少なくとも1以上の 電子線発生源が形成されている請求項9記載の画像形成 装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、画像形成を行なう平面 型の画像表示装置およびその製造方法に関する。

[0002] 【従来の技術】従来、画像形成を行なう蛍光表示管、ブ ラズマディスプレイ、電界放出型のスピントタイプの電 子線発生装置を用いた表示装置、古典的な従来の表面伝 進形電子放出業子を用いた表示装置など、蛍光体を励記 し発光表示させる画像表示装置は、平面でかつ明るく見 やすいなどの利点を有しており、産業上、積極的に応用 され、かつ期待されている。

【0003】例として、図9に従来の蛍光表示管、図1 0に従来のプラズマディスプレイを示した。

【0004】製造方法としては、図9に示す蛍光表示 30 管、図10に示すプラズマディスプレイのリアプレート 24とフェースプレート30と外枠部材21を気密に封 着する際に、リアプレート24および/またはフェース プレート30と外枠部材21とを封着材22を介して接 合する。具体的には例えば、低融点フリットガラスを主 成分としたペースト状の封着材を印刷、スプレイなどの 手段により両プレートの接合部に除布した後、両プレー トと外枠とを積層し、加圧および加熱焼成を行なうこと によって、リアプレート24、フェースプレート30、 外枠部材21および封着材22による気密封着を達成

[0005]

「発明が解決しようとする趣類」しかしながら、上述し た従来例の蛍光表示管、プラズマディスプレイなどの画 像表示装置の製造方法では、リアプレートと外枠部材、 フェースプレートと外枠部材との間に封着材が介在した 状態で接合が行なわれているために、製造された画像表 示装置には、以下のような問題点がある。

【0006】(1)封着材の徐布厚ムラにより、リアプ レートとフェースプレートとの間の距離にパラツキが生

-18-

引 ツキが生じ、順像の均一性が低下する。また、特にリア ブレートとフェースブレートとの間の発揮を小さくし、 極めて棒い平面型の画像表示接触、高精度に発光能を形 成することが要求される平面板の画像表示接触において このような問題が顕著である。

[0007] (2) 封着材の敷布厚ムラにより、リアプレートとフェースプレートとの間の距離にパラツキが生 じるために、封着材の加圧、加速機成工程において内閣 応力が発生し、封着後の微小クラック、封着不良による スローリークが発生する。また物に、リアプレート、フ 10 ェースプレートないし外枠部材に販炉の薄いものを用い る場合、上記の間隔が顕著である。

【0008】(3) 封着材の整布ムラを低減させるため に、封着材の粘度管理等が必要となり、製造工程が煩雑 となる。

【0009】本発明は、上記のような従来技術の欠点を 解決した順像表示装置の製造方法を提供することを目的 とする。

[0010]

造する。

【課題を解決するための手段】上記目的を建成するため 20 に木列則は、闽線表示面を有する容器部基を含む 2以上 の容器部材が接合されてなる列間影を具傷した国権支示 装置において、各容器部材が順接接する部分を有し、実 質的に対象材を介入させないい態で接合させることを特 数との画像表示技能の製造方法およびその方法で製造 される画像表示技能の製造方法およびその方法で製造 される画像表示技能の製造方法

[0011] すなわち、本発明の回換表次展面の転着方法では、(a) 回憶表示面を有するフェースプレート、仕かし、 たちびに (c) フェースプレート およびリフプ シート、 ならびに (c) フェースプレート およびリフプ シート 国の 母縁部に介在する分件配材などの容易部刻を、(1) 互いに直接接触するように基か合わせて外囲器の骨を形成し、接触部の外周部を封禁材で気能に封着して接合してから、もしくは(2) 各容器部が動管台面の一部の内部に清を設け、その中に封着材を入れてから組み合わせて気能に対象して接合し、外風器を形成して加る原本形式を開せる

[0012]以下、図面を用いて本発明の画像表示装置 の製造方法について詳述する。

[0013] 図1および図2は、本発明の製造方法の1 実施艦権を示す図である。図3、図7および図8は、本 発明の製造方法により作成される画像表示装置の1実施 総終を示す図である。図4、図5および図6は、本発明 の製造方法の他の実施総様を示す図である。

[0014] 図2において11は外枠部材、2は封着材、 3は外枠、図1において13はフェースプレート、4は 電子線発生装置が形成された絶縁性基体からなるリアプレートを示す。

【0015】 本発明の画像形成装置の製造方法における 50 封着材収納部に封着材2を整布形成し、加熱焼成するこ

外枠部材1、フェースプレート13、リアプレート4 は、青板、石英などのガラス基体、A1:O:などのセラ ミックス基体などで形成されている。

[0016]また、外枠離析には対常者が収納されて いる対常材収納部の形成は、化学的た気料法、機械研削は などの方法で所盤の形状に加工形成することによって行 なう、封常材収納部の形状は、図2に示したものに限ら れるのではなく、図4(a)、(b)および(c)の 所順関に示すようなものとすることもできる。

[0017] また、封着材2はリアプレート4とフェースプレート13が外内3を介して気密封着できる材料であれば、どのような材料で構成されていても構かない。中でも時に、その材料の具体例を挙げるたらば、非結晶性の低級点フリットガラス、終品性の低級点フリットガラスなどがあり、それらを有機溶剤と配合したり、ニトロセルロースなどのイインダと、そのパインダと物を含さる有機溶剤とを混合させて、エノトはに高合し、少なくとも対象材2の造布作業且度では粘着性があるものを用いる。吸えて言うまでもないが、差布方法に合わせて関合した分析者と用いる。また観えて言うまでもないが、フェースプレート13、リアプレート4、外枠3と対着材2の熱節振り探ば同一となる材料を選択するとか何事といった。

[0018] また、封着材2の塗布方法は、印刷法、ス ブレー法、ディスペンサーによる注入法などどのような 方法であってもよく、封着材収納部に所望の封着材を所 望の量だけ塗布形成できればよい。

[0019] 氷に、厚いに示すように、電子解発性装置が形成されたリアプレート4上に、外枠部材1と創業が とにより形成された外名3を配置し、さらにその上がに フェースプレート13を配置して、対数42に用いた低 版点フリットガラスが溶散する退皮、例えば約3500 ~65000軌間内の温度で加熱して溶着させる。 た、必要に応じてフェースプレート13もしくはリアプ レート4個から加けてみ、

[0020] 以上のように、本発明の製造方法によれ は、図3に示した画像表示装置のごとく、リアプレート イとフェースプレート13と外枠部材1とが接する接面 に封着材の介在なしに気密封着が行なわれる。

[0021] また図5および6に示すように、外や部材 1の少なくとも一部に突き当て第14を設けることによ り、リアブレト4とフェースブレート13と分枠部材 1とか建する接触に封着材の介在なしに気を封着できる 近かりでなく、リアブレート40とくはフェースプレー ト13の基体端面と外枠3の突き当て部14の端面とを 突き当てることにより、位置合わせができるような形態 とすることもできる。

【0022】また図7および8に示すように、外枠部材 1の外周に枠15を設け、封着材収納部を形成し、その

5 とにより、同様にリアプレート4とフェースプレート1 3と外枠部材1とが接する接面に封着材の介在なしに気 密封着されるようにすることもできる。また、封着材収 納部は、リアプレート4またはフェースプレート13に 形成してもよい。

【0023】また、リアプレート4上に形成される電子 線発生装置には、フィラメント状の熱電子源を用いた蛍 光表示管、放電を用いたプラズマディスプレイさらには パルク型と薄膜型に分類される冷陰極素子などがある。

[0024] 例えばパルク型の例としては、FE [W. P. Dvke & W. W. Dolan, "Field emission", Advance in El ectron Physics, 8, 89 (195 6) 1 や、AvalancheタイプやNEAタイプの 半導体 [J. A. Burton, "Electron emission from silicon", Ph ys. Rev., 108, 1342 (1957)] 55 WitingO ["Tung-sol confirms cold cathode tube", Electr onics News (26, Jan. 1959)], 他に、ホトカソード等が知られている。

[0025] 一方、薄膜型の例としては、MIM[C. A, Mead, "The tunnel-emissi on amplifier, J. Appl. Phy s. . 32. 646 (1961) 1 やスピントタイプ [C. A. Spindt, "Physical pro perties of thin-film fiel demission cathodes with m olvhdenum cones", J. Appl. P 伝導形電子放出素子 [M. I. Elinson, Rad io Eng. Electron Phys., 10, (1965)] などがある。

【0026】表面伝導形電子放出素子は、基板上に形成 された小面積の薄膜に、膜内に平行に電流を流すことに より、電子放出が生じる現象を利用するものである。

【0027】この表面伝導形量子放出素子としては、前 記エリンソンなどにより開発されたSnO2(Sb)薄 雌を用いたもの、Au薄膜によるもの「G. Dittm 17 (1972)]、ITO薄膜によるもの[M. Ha rtwell and C. G. Fonstad:" I EEE Trans. ED Conf. ", 519 (1 9 7 5)]、カーボン薄膜によるもの「荒木久ら;真 空、第26巻、第1号、22頁(1983)]などが報 告されている。

【0028】また特別平1-200532号公報および 特開平2-56822号公報においては、電極間に微粒 子膜を配置し、これに通電処理を施すことによって電子 放出部を設ける表面伝導形電子放出素子が示されてい 50 し、微粒子膜8を通電処理(フォーミング処理) するこ

る。これらどのような電子発生装置を用いても構わな W.

[0029]

【実施例】

(実施例1) 本発明の画像表示装置の製造方法を示す工 程図を図1および図2に示し、その方法によって製造さ れる画像表示装置の断面図を図3に示す。

[0030] 図1、2および/または3において、1は 外枠部材、2は封着材、3は外枠、4は絶縁性基体から 10 なるリアプレート、13はフェースプレート、9はガラ ス基体、10は透明電極、11は蛍光体、12はメタル パックである。また、この装置では公知の表面伝導形電 子放出素子を用いており、5は制御電極(変調手段)、 6 は絶縁層、7 は素子電極、8 は電子放出部 (領域) を 有する微粒子膜である。

【0031】図1および2に示した工程は以下の通りで

【0032】(1)外枠部材1として青板ガラスを用 い、所定の寸法に裁断加工し、研削加工にて排気孔32 20 を形成した (図2a)。

【0033】(2)外枠部材1の所定の部分を研削加工 し、封着材収納部を形成した(図2b)。

[0034] (3) 外枠部材1の封着材収納部に、ディ スペンサーを用いた注入法により低融点ガラス(日本電 気硝子 (株) 製、LS/3081) とエチルセルロース とを溶剤に溶かして得られた溶液を塗布形成し、外枠3 とした(図2c)。

【0035】(4)次に、リアプレート4として青板ガ ラスを用い、有機溶剤により十分に洗浄した後、真空蒸 hys., 47, 5248 (1976)] あるいは表面 30 着技術、フォトリソグラフィー技術により、制御電極 5. 絶縁層6を形成し、続いてNiからなる素子電極7 を形成した。この時、索子電極間隔L1は3μmとし、 素子電板の幅W₁を500μm、その厚さdを1000 Aとした。

【0036】(5)次に、所定の部分に有機パラジウム (摩野製薬(株)製、ccp-4230)含有溶液を塗 布した後、300℃で10分間の加熱処理をして、酸化 パラジウム (PdO) 微粒子 (平均粒径:70A) から なる微粒子膜8を形成した。その幅 (素子の幅) Wを3 er: "Thin Solid Films", 9, 3 40 00 mmとし、秦子電極7のほぼ中央部に配置した。ま た、瞬回は100Å、シート抵抗値は5×10°Ω/□

> 【0037】なおここで、述べる徽粒子膜とは、複数の 微粒子が集合した膜であり、その微縦構造として、微粒 子が個々に分散配置した状態のみならず、微粒子が互い に隣接あるいは重なり合った状態(島状も含む)の膜を 指し、その粒径とは前記状態で粒子形状が認識可能な状 館についての谷を言う。

【0038】(6)次に、素子電極7の間に電圧を印加

--20---

とにより、電子放出部を作成した。

[0039] さらに、本発明に用いた表面伝導形電子放 出来子を詳述するならば、電子放出材料を含む微粒子膜 としては、粒径が十数Aから数 µmの導電性微粒子の膜 あるいはこれら導電性微粒子が分散されたカーボン薄膜 などが挙げられる。中でも特に、その材料の具体例を挙 げるならば、Pd、Ag、Au、Ti、In、Cu、C r. Fe. Zn. Sn. Ta. W. Pbなどの金属: P dO、SnOs、InsOs、PbO、Sb2Osなどの酸 化物導電体; HfB₂、ZrB₂、LaB₆、CeB₆、Y 10 ト4上に形成された電子装置の相違にもかかわらず、実 B₄、GdB₄などの硼化物; TiC、ZnC、HfC、 TaC、SiC、WCなどの炭化物; TiN、ZrN、 HfNなどの窒化物;S1、Geなどの半導体;カーボ ン:AgMg:NiCu:PbSnなどである。そして これらの膜は、真空蒸着法、スパッタ法、化学的気相堆 積法、分散塗布法、ディッピング法、スピナー法などに よって形成される。

7

【0040】さらに、制御電板5の構造としては、本実 施例で作成したように、電子線発生部の裏面に形成し制 御する構造の他に、電子線発生部の上方に電子通過孔を 20 造のものの斜視図を示す。 有した制御電極を配置する構造や、単純マトリックス構 浩などがある。

【0041】(7)次に、電子線発生装置が形成された リアプレート4と外枠3とフェースプレート13を所定 の位置に配置・積層し、上方から1kgのおもりにより 加圧し、大気中で封着熱処理温度410℃、封着熱処理 時間60minの条件下で焼成し、画像表示装置を形成 した (図3)。

【0042】上記のように、本発明の製造方法により作 成した画像表示装置は、リアプレート4もしくはフェー 30 スプレート13と外枠部材1との接合に封着材2を介在 させることなく作成でき、リアプレート4とフェースプ レート13間の距離を一定に保つことができた。また、 リアプレート4とフェースプレート13上に形成された 各構造体の部分での封着不良による微小クラック等の発 生がなく、排気孔32から1×10-6Torr程度まで 真空排気したところ、スローリークの全くない画像表示 装置を形成することができた。

[0043]また、この画像表示装置を駆動、動作させ たところ、リアプレート4とフェースプレート13との 40 間の距離が一定に保たれているために、フェースプレー ト13での発光スポット形状が均一な画像を得ることが できた。

【0044】 (実施例2) 図4aに本発明の方法で製造 される装置の別の例の外枠3の断面図を示す。

【0045】この場合、電子線発生装置にフィラメント を用いた蛍光表示管を用いた。また、外枠3をこの図の ように外枠部材1に溝を設けた構造とした以外は実施例 1と同様に装置を作成した。

[0046] その結果、外枠3の構造およびリアプレー 50 枠15の間の封着材収納部と外枠部材1上のフェースプ

ト4上に形成された電子線発生装置の相違にもかかわら ず、実施例1と同様の効果が確認できた。

【0047】(実施例3) 図4bに本発明の方法で製造 される装置のさらに別の例の外枠3の断面図を示す。

【0048】ここでは、電子線発生装置としてプラズマ 発生装置を用いた。また、外枠3を同図のように外枠部 材1に三角溝を設けた構造とした以外は実施例1と同様 に装置を作成した。

【0049】その結果、外枠3の構造およびリアプレー 施例1と同様の効果が確認できた。

【0050】 (実施例4) 図4cに本発明の方法で製造 される装置のさらに別の例の外枠3の断面図を示す。

【0051】この場合、外枠3に丸溝の封着材収納部中 に封着材2が形成された構造とした以外は、実施例1と 同様に装置を作成した。

[0052] その結果、外枠3の構造が異なるにもかか わらず、実施例1と同様の効果を確認できた。 [0053] (家族例5) 図5に外枠3がさらに別の構

[0054] この場合、外枠3にフェースプレート13 を外枠3とを位置合わせするための突き当て部14を設

けた以外は実施例1と同様に装置を作成した。 【0055】その結果、実施例1と同様の効果を確認で きたばかりか、リアプレート4とフェースプレート13 の位置合わせを外枠3の突き当て部14にフェースプレ ート13を突き当てて製造できることから、容易かつ精 度良くリアプレート4とフェースプレート13の位置合 わせを行なうことができた。

【0056】(実施例6)図6に外枠3がさらに別の構 造のものの斜視図を示す。

[0057] この場合、外枠3にフェースプレート13 と外枠3、リアプレート4と外枠3とを突き当ててフェ ースプレート13とリアプレート4との位置合わせを行 なう突き当て催14をフェースプレート13、リアプレ ート4が配置される外枠3の両端に設けた以外は実施例 1と同様に装置を作成した。

[0058] その結果、実施例1と同様の効果が確認で きたばかりかリアプレート4とフェースプレート13の 位置合わせがより精度良く行なうことができた。

【0059】(実施例7)図7に本発明の製造方法によ って作成した画像表示装置の別の1例の断面図を示す。 [0060] 図のように、外枠部材1と封着剤収納部を 形成するための枠15とにより、まず電子線発生装置が 形成されたリアプレート4 Eに外枠部材1を配置し、次 いで、フェースプレート13を外枠部材1上に配置し、 次いでフェースプレート13の外周の外枠部材1上に枠 15を配置した。

【0061】次いで、リアプレート4上の外枠部材1と

-21--

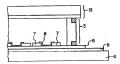
レート13と枠15の間の封着材収納部に封着材2を強 布した。以上の製造工程以外は実施例1と同様にして装 置を作成した。

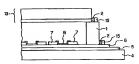
- [0062] その結果、外枠3(外枠部材1、枠15)、フェースプレート13などの配置構成の相違にもかかわらず、実施例1と同様の効果が確認できた。
- 【0063】(実施例8)図8に本発明の製造方法によって作成した画像表示装置の別の1例の断面図を示す。
- って作成した国家表示表面の別の1列の前面図とかり。 【0064】図のように、外枠部材1とフェースプレー
- を塗布形成した。なお、枠15の高さは外枠部材1の高 さ以上、フェースプレート13の端面と外枠部材1を合 わせた高さ未満であることが望ましい。以上の工程以外 は実施例1と同様に装置を作成した。
- 【0065】その結果、実施例1と同様の効果が確認できた。
- [0066]
- 【発明の効果】以上説明したように、本発明の製造方法 によれば、フェースプレートもしくはリアプレートと外 枠部材との間に封着材が実質的に介在しない、すなわち 国さ 方向の寸法への封着材の寄与がないことから、
- (1) フェースプレートとリアプレートとの開幕を一定 にでき、(2) 封着部分での敬小クラック、封着不良が 低減し、歩留りが向上し、(3) 封着材の強布厚を制御 する必要がないため、製造方法を関島となるなどの効果 がある。
- 【図面の簡単な説明】
- 【図1】 本発明の製造方法の1例における接合工程を示す工程図である。
- す工程図である。 【図2】本発明の製造方法の1例における外枠形成を示
- す工程図である。 【図3】本発明の画像表示装置の1例の模式的断面図で

ある。

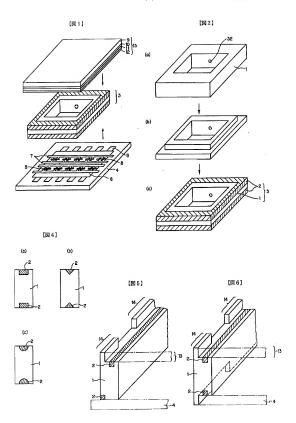
- 【図4】 本発明の画像表示装置の他の例における外枠部 分の模式的斯面図であり、a、b、c はそれぞれ封着材 収納部の形状が異なる。
- 【図5】本発明の画像表示装置の接合状態の1例を示す 様式図である。
- 【図 6】 本発明の画像表示装置の接合状態の他の1 例を 示す模式図である。
- 【図7】本発明の画像表示装置の別の1例を示す模式的 断面図である。
- 【図8】本発明の画像表示装置の別の1例を示す模式的 断面図である。
 - 【図9】従来の画像表示装置の1例の模式的部分断面図
- である。 【図10】従来の画像表示装置の他の1例の模式的部分 断面図である。
- [符号の説明]
- 1,21 外枠部材
- 2,22 封着材
- 3 外枠
- 4,24 リアプレート (絶縁性基体)
- 5. 7. 23. 25, 32 電極
- 6、33 絶縁層
- 8 微粒子腺
- 9,30 ガラス基体
- 10,31 透明導電膜
- 11,26 蛍光体 12 メタルバック
- 13 フェースプレート
- 14 外枠部材の突き当て部
- 15 枠
- 27 表示部
- 28 制御電極
- 29 フィラメント
- 32 排気孔

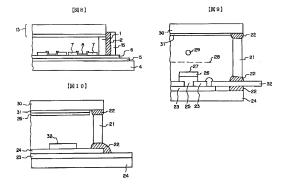
[図3]





[図7]





[0017] The sealing member 2 may be composed of any material that can airtightly seal the rear plate 4 and the face plate 13 with the outer frame 13 therebetween. Such material includes noncrystalline low-melting frit-glass and crystalline low-melting frit-glass, among others, which are to be mixed with organic solvent, or prepared in paste form by mixing binder such as nitrocellulose and organic solvent that solves the binder, and they need to be adhesive at least at a temperature at which the sealing member 2 is applied. Needless to say, the sealing materials must be prepared in a way suitable for an application method to be used. Also, needless to say, materials of the face plate 13, rear plate 4, outer frame 3 and the sealing member 2 are preferably selected so that they will have similar coefficient of thermal expansion.

[0029]

[Examples]

(Example 1) Figs. 1 and 2 illustrate a flow of a manufacturing process of an image display device of the present invention.

Fig. 3 is a sectional view of an image display device manufactured through the process of the Figs. 1 and 2.

[0030] As shown in Figs. 1, 2 and/or 3, the image display device includes an outer frame member 1, a sealing member 2, an outer frame 3, a rear plate 4 made of insulative substrate, a face plate 13, a glass substrate 9, a transparent electrode 10, a phosphor 11 and a metal back 12. Furthermore, the device

includes a known electron-emission element of surface conduction type having a control electrode (modulation means) 5, an insulating layer 6, an element electrode 7 and a fine particle film 8 with an electron-emission part (area). [0031] The process shown in Fig. 1 and 2 is described below.

[0032] (1) The outer frame 1 is made of soda-lime glass, which is cut in predetermined dimensions and provided with an exhaust hole 32 formed by grinding (see Fig. 2a).

[0033] (2) A predetermined portion of the outer frame 1 is ground, forming a recess for the sealing member (see Fig. 2b). [0034] (3) A solution of low-melting glass (LS/3081 from Nippon Electric Glass Co., Ltd.) and ethyl cellulose dissolved with solvent is applied onto the recess of the outer frame 1 using injection method with a dispenser, forming the outer frame 3 (see Fig. 2c).

[0035] (4) Next, the rear plate 4 is made of soda-lime glass, which is thoroughly washed with organic solvent, and on which, using vacuum deposition and photolithography techniques, the control electrode 5 and the insulating layer 6 are formed, and then the element electrode 7 is formed with Ni. At this point, the interval of the element electrodes L1 is 3 um, the width between the element electrodes W1 is 500 μm , and the thickness of the element electrodes d is 1000 angstrom.

[0036] (5) Next, the fine particle film 8, composed of palladium oxide (PdO) fine particles with the average particle diameter of 70 angstrom, is formed by applying organopalladium (ccp-4230 from Okuno Chemical Industries Co., Ltd.) containing solution onto a predetermined portion and heating it at 300°C for ten minutes. The fine particle film 8 with the

width (the width of elements) of 300 μm are located at almost the center of the element electrode 7. The thickness of the film 8 is 100 angstrom, and the sheet resistance is 5 x 10 4 Ω/\Box . [0037] As used herein, a fine particle film means a film formed by aggregation of multiple fine particles, and its fine structure means not only the state that individual particles are discretely located, but also the state that the particles are adjacent to or overlapping each other, some times in island form. Then particle diameter as used herein means diameter of a particle where individual particle shapes are distinguishable in the states described above.

[0038] (6) Next, the electron-emission part is formed by applying a voltage between element electrodes 7 and performing conducting process (forming process) over the fine particle film 8.

[0039] Regarding the electron-emission element of surface conduction type used in the invention, a fine particle film containing electron-emission material may be a film of conductive fine particles whose diameter is from ten angstroms to several micrometers or a carbon thin film over which these conductive fine particles are dispersed. Such material includes, among others, metal such as Pd, Ag, Au, Ti, In, Cu, Cr, Fe, Zn, Sn, Ta, W and Pb; conductive oxide such as PdO, SnO₂, In₂O₃, PbO and Sb₂O₃; boride such as HfB₂, ZrB₂, LaB₆, CeB₆, YB₄ and GdB₄; carbide such as TiC, ZnC, HfC, TaC, SiC and WC; nitride such as TiN, ZrN and HfN; semiconductor such as Si and Ge; carbon; AgMg; NiCu; and PbSn. These films may be formed using method such as vacuum deposition, sputtering, chemical vapor deposition, dispersive coating, dipping or spinner

method.

[0040] In addition to the structure that is formed and controlled on the back side of the electron-emission part, as described in the present example, the structure of the control electrode 5 may be a structure where a control electrode having an electron passing hole is placed above the electron-emission part or a simple matrix structure.

[0041] Next, the rear plate 4 on which the electron-emission part is formed, the outer frame 3 and the face plate 13 are placed and stacked at respective predetermined locations, then pressurized from above by a weight of 1 kg, and then fired in air at the sealing heat treatment temperature of 410°C for the sealing heat treatment duration of 60 minutes, forming the image display device (see Fig. 3).

[0059] (Example 7) Fig. 7 is a sectional view of another example of the image display device manufactured according to the manufacturing process of the present invention.
[0060] As shown, first, an outer frame member 1 is placed on a rear plate 4 on which an electron-emission part is formed.
Then a face plate 13 is placed on the outer frame member 1.
Then a frame 15, on which a recess for a sealing member is to be formed, is placed on the outer frame member 1 at the perimeter of the face plate 13.

[0061] Second, a sealing member 2 is applied onto the sealing member recess between the outer frame member 1 and the frame 15 on the rear plate 4, and is also applied onto the sealing member recess between the face plate 13 and the frame 15 on the outer frame member 1. Except for the above process, the

same process as in the example 1 is used for manufacturing the image display device.

[0062] As a result, the same effect as in the example 1 was observed in spite of the difference of the configuration of the outer frame 3 (the outer frame member 1, the frame 15), the face plate 13 and so on.

[0063] (Example 8) Fig. 8 is a sectional view of another example of the image display device manufactured according to the manufacturing process of the present invention.

[0064] As shown, first, the outer frame member 1 is placed on a rear plate 4. Then a rear plate 13 is placed on the outer frame member 1. Then a frame 15 is placed at the perimeter of the outer frame member 1. As a result, a sealing member recess is formed on the outer frame member 1 and the substrate edge face of the face plate 13. Then, a sealing member 2 is formed by being applied onto the sealing member recess surrounded by the outer frame member 1, the edge face of the face plate 13 and the frame 15. Desirably, the height of the frame 15 is higher than the outer frame member 1 and lower than the total height of the edge face of the face plate 13 and the outer frame member 1. Except for the above process, the same process as in the example 1 is used for manufacturing the image display device.

[0065] As a result, the same effect as in the example $1\ was$ observed.

[0066]

[Advantageous effect of the invention] As described above, due to the fact that a sealing member does not exist substantially between a face plate or rear plate and an outer frame member, meaning that the sealing member does not contribute to the dimension in thickness direction, the manufacturing process of the invention provides the following advantages: (1) the distance between the face plate and the rear plate can be constant; (2) microcrack generation and sealing failure in sealed portion can be reduced and production yields can be improved; (3) the manufacturing process can be simplified because it is not necessary to control the coating thickness of the sealing member.